#### rching by Document Number

Result [Patent] \*\* Format (P801) 29. Oct. 2001 pplication no/date: 1989-338028[1989/12/26] ate of request for examination: ublic disclosure no/date: 1990-245655[1990/10/01] xamined publication no/date (old law): legistration no/date: xamined publication date (present law): 'CT application no: 'CT publication no/date: pplicant: UNIV LELAND STANFORD JR

nventor: GUREKORII TEI EI KOBUATSUKUSU, ERITSUKU SHII HOORANDO

GO1N 27/447 B01D 57/02 xpanded classicication: 462,131 ixed keyword: R002, R004, R044, R097

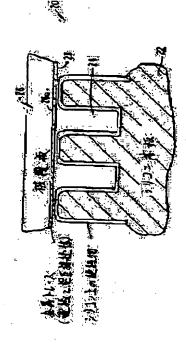
itle of invention: ELECTROPHORETIC SYSTEM

bstract:

PURPOSE: To make it possible to separate molecules having slightly different electron mobility or the other electrophoretic characteristics by providing a microscopically deep groove in a board by semiconductor processing technology.

CONSTITUTION: A device 20 is formed of a substrate 22 made of silicon wafer. The substrate 22 has one or more deep grooves 24 patterned by a photolithography method. To obtain the bare silicon, the oxide of the part exposed with the pattern is etched down by plasma ion. The depth of the groove 24 can be altered by changing the etching time, reactive gas composition and concentration. The sidewall of the groove 24 has a wet oxide grown layer or a covering layer of other material, and the silicon is operated as an insulator to electrically insulate it from the content of the groove 24. The groove 24 is covered by a covering plate 26, which can be formed of pyrex glass. To apply an electric field to the content in the groove 24. metal trace 28 is deposited on the inner surface 26a of the plate 26. COPYRIGHT: (C) 1990, JPO

# THIS PAGE BLANK (USPTO)



## THIS PAGE BLANK (USPTO)

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

### ◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-245655

®Int. Cl. 5

識別配号

庁内整理番号

④公開 平成2年(1990)10月1日

G 01 N 27/447 B 01 D 57/02

8506-2G G 01 N 27/26 3 3 1 Z 審査請求 未請求 請求項の数 37 (全30頁)

**公発明の名称** 電気泳動系

20特 願 平1-338028

②出 願 平1(1989)12月26日

優先権主張 21988年12月30日 30 米国 (US) 30 292409

**@発 明 者 グレコリー テイ。エ** 

イ、コヴアツクス

**②発明者 エリック シー・ホー** 

ランド ⑦出 願 人 ザ、ボード、オブ、ト

ラスティーズ、オブ、 ラスティーズ、オブ、 ザ、リーランド、スタ ンフオード、ジュニ ア、ユニパーシティ

個代 理 人 弁理士 井ノロ 壽

アメリカ合衆国、94301 カリフオルニア州 パウロ アルトウ、ホーソーン 275 アパートメント 118 アメリカ合衆国、94026 カリフオルニア州 メンロ パーク、ロウプレイ アヴエニュー 838 ナンパー2 アメリカ合衆国、94305-6225 カリフオルニア州 スタンフオード、セラ ストリート 857、セカンド フロア

明知音

1.発明の名称

電気泳動系

#### 2. 特許請求の範囲

(1) 少なくとも一つの深溝を有する基板と、電気 泳動過程の生じている期間に電解質、および一つ 以上の成分を有する電気泳動性試料を保持するの に適した延長空間を深溝の形で形成し、深溝を被 遭するための前記表面に接触させるために採用さ れた被覆と、

深得を介して電解質および試料を移動させるとと もに、試料をその複数の成分に分離するための電 界を深沸に印加するための手段と

から成る電気泳動デバイス。

- (2) 前記被覆は延長空間を形成するための基板に接触している表面を有し、かつ、前記電界印加手段は表面上に電極を有する特許請求の範囲第1項記載のデバイス。
- (3) 前記基板は表面を有し、かつ、前記電界印加 手段は基板表面上、あるいは基板表面の近傍に複

数の電極を備えた特許請求の範囲第1項記載のデ パイス。

- (4) 前記電界印加手段は、さらにトランジスタ手段を備えた特許請求の範囲第3項記載のデバイス。
  (5) 前記深溝は2端を有し、かつ、深溝の一端には電解質がまりを有し、前記電界印加手段は第1の電圧を深溝の2端、ならびに2端間の一つ以上の点に対して印加し、前記点および前記点の近傍において試料内のイオンをフォーカスするための手段、ならびに第2の一対の電圧を順次、2端および一点に印加し、フォーカスされたイオンを電解質がまりの方へ移動させるための手段を備えた特許請求の範囲第1項記載のデバイス。
- (6) 前記電界印加手段は電解質源において第1の電極を有し、電解質だまりにおいて第2の電極を有し、前記点および前記点の近傍において第3の電極を有する特許請求の範囲第5項記載のデバイ
- (7) 2 増を有するとともに少なくとも2つの深溝

- (B) 前記深溝は実質的に流れの方向に垂直な方向へ、その寸法が実質的に100ミクロンを越えないように構成した特許請求の範囲第1項記載のデバイス。
- (9) 前記基板は、その内部で実質的には相互に平

行した2つ以上の深溝を定義しているものである 特許請求の範囲第1項記載のデバイス。

- 60 前記基板は、その内部で実質的には中心点に対して半径方向への2つ以上の深溝を定義しているものである特許請求の範囲第1項記載のデバイス。
- 一つ以上の成分の存在を検出するための一つ以上の検出器を備えた特許請求の範囲第1項記載のデバイス。
- (2) 前記被覆は延長空間を形成するため基板表面に接触する第2の表面を有し、前記検出器は第2の表面の近傍に被覆の一部分を形成するものである特許請求の範囲第11項記載のデバイス。
- (3) 前記検出器は表面上、あるいは表面の近傍に 基板の一部を形成するものである特許請求の範囲 第11項記載のデバイス。
- 69 前記検出器は深溝に近接するか、あるいは深 溝内に置かれるべく採用された支持体に装着され たものである特許請求の範囲第11項記載のデバ

イス。

四 前記深溝は2端を有する特許請求の範囲第1 1項記載のデバイスであって、

前記検出器は相互に近接し、かつ、深溝の一端から異なった距離にある少なくとも2つの電極と、電解質の当該部分および2つの電極の近傍に存在する成分を介して前記2つの電極間に電流を流すための手段と、

2つの電極の近傍に存在する成分を検出するための電流を測定するための手段と、

から成る特許請求の範囲第11項記載のデバイス。 60 前記2つの電極が延長構造のものであり、かつ、深溝に対して機方向に配置されたものである 特許請求の範囲第15項記載のデバイス。

00 深溝は蛇管状、巻き形、あるいは螺旋状を有するものである特許請求の範囲第1項記載のデバイス。

四 電気泳動過程の生じている期間に電解質。ならびに一つ以上の成分を有する電気泳動性試料を保持するのに適した少なくとも一つの深溝を内部

に定義している半導体基板を備えて構成した電気 泳動デバイスであって、

前記基板は深溝を介して電解質を移動させ、かつ、 試料をその複数成分に分割するための電界を深溝 に印加するための手段を定義している部分を有す るものである電気泳動デバイス。

- (19) 深溝は蛇管状、巻き形、あるいは螺旋状を有する特許請求の範囲第18項記載のデバイス。
- 四 電気泳動過程の生じている期間に電解質源と 電解質だまりとの間の予め定められた方向に沿っ て、一つ以上の成分を有する試料を通過させるの に適した媒体と、複数成分を前記方向に移動させ るとともに試料をその複数成分に分割するため、 電解質源および電解質だまりにおける電界、なら びに電解質源と電解質だまりとの間の少ならも 一点における電界を媒体に印加するための手段と から成る電気泳動デバイス。
- (21) 前記電界印加手段は媒体内, あるいは媒体 近傍の複数電極から成る特許請求の範囲第20項 記載のデバイス。

- (22) 前記電界印加手段は電圧を電解質点、電解 質だまり、ならびに電解質点と電解質だまりとの 間の複数の点に印加するための方向に対して機方 向に配置された複数の延長形電極から成る特許請 求の範囲第20項記載のデバイス。
- (23) 特許請求の範囲第21項記載のデバイスであって、さらに電解質源と電解質だまりとの間の 複数の点における複数成分を検出するための複数 の検出器から成る特許請求の範囲第21項記載の デバイス。

#### (24) 前記検出器は

相互に近接した少なくとも2つの電極と、媒体の 当該部分、ならびに2つの電極の近傍に存在する 成分を介して前記2つの電極間に電流を通過させ るための手段と、

2つの電極の近傍に存在する複数成分を検出するための電流を測定するための手段と

から成る特許請求の範囲第23項記載のデバイス。 (25) 前記2つの電極は延長形に構成され、電解 質源と電解質だまりとの間の方向に対して横方向

複数の電圧を複数の電極に印加するための手段とから成るデバイスを採用した電気泳動法であって、 荷電のある試料成分を第3の電極の近傍に引きつけるため、電解質源電極および電解質だまり電極よりも高いか、あるいは低い電位に第3の電極の電位を設定するため、複数の電圧を複数の電極に 印加するための第1のステップと、

第3の電極の近傍における試料成分を電解質だまりの方へ移動させるため、複数の電圧を複数の電極に印加するための第2のステップとから成る電気泳動法。

- (30) 第3の電極の近傍における複数試料成分の一部分を電解質だまりの方に加速するとともに、 残りの部分を電解質額の方に加速するため、第1 のステップの期間に第3の電極へ印加されたもの とは逆の極性の電圧を、第2のステップの期間に 第3の電極へ印加するためのステップを含む特許 請求の範囲第29項記載の方法。
- (31) 電気泳動過程の生じている期間に電解質憑と電解質だまりとの間の予め定められた方向に沿

に配置された特許請求の範囲第24項記載のデバー イス。

- (26) 前記試料の少なくとも一つの成分は蛍光材料で符号付けられており、かつ、前記検出器は前記材料により発光した光の検出に適したものである特許請求の範囲第23項記載のデバイス。
- (27) 前記検出器はPINダイオード形検出器。 ホトトランジスタ、あるいは電荷書積形摄像素子 である特許請求の範囲第26項記載のデバイス。
- (28) 前記検出器はPINダイオード形である特許
  計算水の範囲第23項記載のデバイス。
- (29) 電気泳動過程の生じている期間に電解質想 と電解質だまりとの間の予め定められた方向に沿 って、一つ以上の成分を有する試料を通過させる のに適した媒体と、

電解質源、電解質だまり、および電解質源と電解質だまりとの間の複数の点に対して複数の電圧を 印加するための方向に対して機方向に配列された 電解質源電極、電解質だまり電極、ならびに電解 質源に近接した少なくとも一つの第3の電極と、

って、一つ以上の成分を有する試料を通過させる のに適した媒体と、

電解質源、電解質だまり、および電解質源と電解 質だまりとの間の複数の点に複数の電圧を印加す るための方向に対して微方向に配列された複数の 電極と、

複数の電圧を複数の電極に印加するための手段と を備えたデバイスを採用した電気泳動法であって、 3つの隣接した電極より成る第1のグループに対 して、第1の電極を定義する電解質源に最も近い 電極は、試料の一成分を前記第1の電極の方に引 きつけるためグループ内の残りの複数電極よりも 高いか、あるいは低い電位に保たれるように、複 数の電圧を複数の電極に印加するための第1のステップと、

第1のステップの期間に第1の電極に引きつけられていた成分を第2の電極の方へ引きつけるため、第2の電極の電位は第1のステップの期間に第1の電極の電位に従って変化する傾向を有するように、第1の電極に直ぐ近接し、かつ、第2の電極

を定義している前記予め定められた方向で下流に ある電極に加えられた電圧を変化させるための第 2のステップと

を備え、かつ、

第2の電極に直ぐ近接し、かつ、第3の電極を定 義している前記予め定められた方向で下流にある 電極に加えられた電圧は、前記方向で下流にある 成分の拡散が減ぜられるような電位に保たれてい る電気泳動法。

(32) 第1のステップの後の予め定められた時刻において、成分が第1の電極の方へ逆方向に拡散するのを防ぎ、これにより前記成分を第1の電極の近傍から第2の電極の近傍へ、さらに電解質だまりの方へと輸送させるため、第1の電極に印加された電圧を変化させるための第4の手段をさらに含む特許請求の範囲第31項記載の方法。

(33) 予め定められた方向に沿って前記第1のグループに近接するとともに前記第1のグループの下流にある一つ以上の複数電極より成るグループに対して、前記第1のステップ~第4のステップ

第5のステップを含む特許請求の範囲第32項記載の方法。

3.発明の詳細な説明

<産業上の利用分野>

本発明は、電気泳動系に関し、特に物質を分離および検出するために品質を改善した電気泳動系に関する。

#### く従来の技術 >

電気泳動法は電荷を有する物質、特に生体重合の分離および分析のために重要な技術となってきた。 重合体ゲルは分離媒体として使用されてきた。 かかるゲルは、分離を妨害する輸送と流出とを減ずるようなものである。しかしながら、ゲルを採用している電気泳動系では、要求される応用に応じて系が単純にはならない。

細い毛細管における毛細管帯電気泳動法(C2E)は、ゲル形の電気泳動系の代替としても開発されている。電界は毛細管の2端間に印加され、毛細管には電気泳動性を有する試料を含む電界質が導入されている。電界は、電解質ならびに試料

を繰り返し、当該成分をさらに電解質だまりの方に輸送させる特許請求の範囲第32項記載の方法。 (34) 複数グループ内の電極の数は、当該成分が 電解質だまりの方に輸送されるに伴って減ずるよ うに複数の電圧を複数の電極に印加している特許 請求の範囲第32項記載の方法。

(35) 第1のステップ〜第4のステップを繰り返すための複数の電極より成る複数のグループの間の空間が、希望する移動度を有する試料成分のみを電解質だまりの方向に移動させるように複数電圧を印加している特許請求の範囲第33項記載の方法。

(36) 第1のステップ〜第4のステップを選択された頻度で繰り返す特許請求の範囲第31項記載の方法。

(37) 第1のステップ〜第4のステップから得られた電圧パターンを、第1のグループから一つ以上の電極だけ移動して得られる3つの隣にあった電極より成る第2のグループに対して繰り返すように、複数の電圧を複数の電極に印加するための

に管を通る流れを生じさせている。

電解質および試料が毛細管を通って流れている期間に試料成分が毛細管内の帯に溶解して入り込むように、試料内のある成分は他の成分よりも高い 助電学的移動度を有している。

従来のCZE技術は、溶解能力において、毛細管断面積に対する毛細管円周の比によって制限されている。円筒形の管に対して、この比は管の半径に逆比例する。これは、製造が困難な、極めて小さな穴を有するがラス管を開発することに帰着する。

これらの理由, ならびに下に述べる他の理由により, 上記電気泳動技術は完全に満足なものではない。それゆえ, 改善された品質に性能とを有する電気泳動系を提供することは望ましい。

<課題を解決するための手段>

(発明の要約)

本発明は、ガラス管を使用する代わりに、顕数 歳的深溝を半導体処理技術によりシリコンウェハ のような基板内に製造することができることの観 察に基づいたものである。そのようにして製造された顕微鏡的深溝は、非常に小さな断面寸法を有するように造ることができる。また、本発明では電気泳動性チャネル用半導体基板を使用し、基板中へ電極、検出器、および信号処理回路を実装して、深溝中のあらゆる点での電界を直接、制御し、さらに電気泳動系の汎用性と性能とを改善するために物理的パラメータを検出できることの観察に基づいたものである。

本発明の一様相は、少なくとも一つの深溝を有する基板と、延長された空間を形成している深溝を覆うための前記表面に接触させるために採用された被覆とから成り立つ電気泳動デバイスを預されたものである。空間は、電気泳動造に電気泳動造デバイスは、深溝を介して電気泳動性試料とを保持するのに適、深溝を介して電解質と試料とを移動させ、かつ、試料をその成分に分割するための電界を深溝に印加するための手段から成り立つ。

本発明のさらに他の様相は、デバイスを採用した電気泳動法を直接、指向したものである。 デバイスは、電気泳動過程の生じている期間、電 解質源と電解質だまりとの間で予め定められた方 向に沿って一つ以上の成分を有する試料を通過させるのに適した媒体と、媒体内あるいは媒体に近接し、かつ、電解質源および電解質だまり、なら

本発明のさらに他の様相は、電気泳動過程の生じている期間、電界質源と電界質だまりとの間で予め定められた方向に沿って、一つ以上の成分を有する試料を通過させるのに適した媒体と媒体内あるいは媒体に近接し、かつ、電界質源ならびに電界質だまりに対して電圧を印加する方向に対して横方向に配置された電解質源電極および電解質だまり電極と、さらに上記の他に電解質源に近接

びに電解質源と電解質だまりとの間の媒体内の複 数点に対して電圧を印加するための方向に対して 横方向に配置された電極列と、複数の電極に複数 の電圧を印加するための手段とを具備して構成し たものである。方法は次のステップから成り立つ。 第1のステップでは、電解質源から前記第1の電 極の近傍における媒体内の一点に対して試料の一 成分を引きつけるため、近接した複数電極より成 る第1のグループに対して第1の電極を定義する 電解實想に最近接の電極を第1のグループにおけ る残りの電極よりも高いか、あるいは低い電位に、 保っておくため、複数電極に対して複数電圧を印 加する。第2のステップでは、第2の電極の近傍 で媒体の一部分の方向への第1の過程の生じてい る期間に、第2の電極の電位が第1の電極の方向 へ引きつけられた成分を引きつけるための第1の ステップの生じている期間に第1の電位に従う傾 向を有するように、第2の電極を定義する第1の 電極に直接、近接した電極に印加された電圧が変 化する。第3のステップでは、第3の電極の近傍

#### <実施例>

第1図は、本発明を説明するための、数小電気 泳動デバイスの一部分の断面図である。第1図に 示すように、デバイス20は例えば従来の半導体 処理技術が適用できる材料の基板を備えている。

および加えたRF電力を変化させることにより、 深溝の深さを変えることができる。次のステップ は深溝側壁の酸化であり、これは再び温式酸化物 成長層、あるいは下に協論するような他の材料を 使った被覆を介したものである。酸化物層あるい はシリコン上の他の材料での被覆層は、シリコン を電気的に深溝24の内容物と絶縁するための絶 縁物として働く。

ある種の泳動応用においては、深溝24は被覆する必要性がない。深溝24の断面が狭く、深溝の地では、これは真実である。深溝が被記されていない処では、第2図を参照して下に記述したように、基板22内に造られた電極およる。では、電子を深溝の内容物に加える。では、深溝24は被覆板26により覆われている。板26はパイレックスがラス、あるでは、深溝24は被覆板26によりである。板26はパイレックスがラス、あるに、深溝24はなである。電界を深流の内容物に加えるため、金属トレース28が板26の内側表面26a上にデポジットされている。

一実施例においては、基板22はシリコンから成 り立つ。デバイス20を製造するための出発材料 は、それゆえシリコンウェハである。"湿式法" によって成長させた酸化物(SiOa)はウェハ を覆うため、ほぼ1000℃で水蒸気を満たした 炉内でウェハ上に成長される。この酸化物層は処 理を観察するのに便利であるが、厳密には必要で はない。そこで、ホトレジストをウェハの上側表 面に適用し、ウェハは一つ以上の深溝を形成する のに望ましいパターンを有し、ホトリソグラフ法 でパターン化される。パターンの露光された部分 の酸化物は、むき出しのシリコンを得るため、例 えば塩素のような、種々のプラズマ化学の一つを 使用してプラズマイオンあるいは反応性イオンで 下方へエッチングされる。この点で、深溝は弗案 化学を使用してプラズマエッチしたものであるが、 この手法に限ったものではなく、他のプラズマ化 学エッチング、あるいは湿式化学エッチングが満 足に使用できる。

エッチング時間反応性ガス組成、濃度、全圧力.

深溝は、リン酸塩緩衝含塩物のような電気泳動性 を有する媒体、あるいは、場合によってはポリア クリルアミドのゲルのような従来の電気泳動性を 有する媒体で満たすことができる。流れの方向に 対して実質的に垂直な方向への深溝の寸法は、い かなる方向に対しても100ミクロンを超えては いない。

シリコン内に深溝を造るための半導体処理技術を使用することにより、極めて狭い深溝を造るか とは可能である。これらの深溝を毛細管電気泳動 過程におけるチャネルとして使用するとには対 顕微鏡的大きさの深溝は表面積の断過程の分解に対する 比が著しく大きいので、電気泳動過程の分解は数さ クロンのオーダの大きさにすることができるの場 合、試料を電気泳動法的にその複数成分に気 会に対する。この理由により、完全なができる。 にができる。この理由により、完全なができる。 デバイスをシリコンチップ上に置くことができる。 これにより、診療所で使用するのに理想的な、低 価格で使い捨てのシーケンスチェンパが得られる。 近い将来、DNA分析は日常の医用試験になるも のと期待されるので、デバイス20はかかる分析 を診察所において簡便に行なえるようにするもの である。

て行ってMOSトランジスタの動作を妨害するのを防ぐため、電極と外部接続点とを除いた全での位置にアルカリ阻止用絶縁物で被覆されている。 深溝44がV形の断面を有するものであることは、特記されよう。かかるV溝は、KOHを使用した 湿式の化学的エッチングのような種々のエッチン グ技術によって得ることができる。

裸が一旦エッチングされると、MOSFETが同一基板上に造られるならば、二酸化シリコンのような絶縁物は溝の上にデポジットされるか、あるいはその上に成長される。この点から、従来技術によるMOS製造技術を、同一基板上のトランジスタ50のような能動トランジスタを製造するのに応用できる。

そこで、一つ以上の金属トレース48を溝内に デポジットすることができ、従来の製造技術を使 用してこれをトランジスタに接続することができ る。深溝44のV形断面は第1図の深溝24の垂 直壁よりもゆるい勾配を有しているので、これに より容易にデポジットされた金属を倒壁へ連続的 順で大きな用途があろう。

数千個の深溝をシリコンチップ内に造ることができるので、深溝の流出物は他にもぐり込ませることができる。これにより、分離可能な小容積の毛細管電気泳動法に付随する主な問題の一つが除かれる。

に適合させることができる。

かくして、電極 4 8 において電圧スイッチングが MOSFET 5 0 、および他の (図示されていない) オンチップ電子技術を介して行われる。制御 回路および電極が基板の一部として組み込まれているので、上記のように受動被覆板 4 6 は省略される。かかる場合には、溝の形状は深くするか、あるいは狭くするなどして変更する必要があり、高温度下のような制御された環境下でユニットを動作させる必要がある。

ガラス被覆板のシリコンウェハに対する陽径接着が達成されている。かかる技術は、例えば下記の文献に記載されている。すなわち、

(1)テリー、ジャーマン、アンジェル、『シリコンウェハ上に造られたガスクロマトグラフ法による空気分析器、『アメリカ電気電子学会、電子装置論文誌、第ED-26巻、第12号、第1880~1886ページ(1979年12月)

(2)ディー・アイ・ポメランツ, "陽極接着," 米 合衆国特許, 第3, 397, 278号 (1968 年8月13日発行)。

(3) ジー・ワリス, 『電界の助けによるガラス封じ法, 『電子部品科学技術は, 第2巻, 第1号, 第45~53ページ(1975年)。

(4)ジー・ワリス、ディー・アイ・ポメランツ。

"電界の助けによるガラスー金属封じ法、" 応用物理学会誌(米国), 第40巻, 第10号, 第3946~3949ページ(1969年9月)。

第3図(A)は、本発明を説明するための微小電気泳動デバイスの頂面図であり、デバイス内の深溝ならびに出発電極のレイアウトを示すものである。第3図(A)に示すように、電気泳動デバイス50は、複数の深溝54が、その内部にエッチングで形成されている基板52を備えたものである。深溝54は、第1図および第2図の深溝24、44の断面形を有するか、あるいは製造するものとすることができる。第3図(A)に示すように、深溝54は実質的に相互に平行で、電解質源井戸56と電解質だまり井戸58とを接続するものである。かくして、電

および電極の他のレイアウトを示すものである。 並列の代わりに、微小チャネル5 4 ′ は "ワゴン の車輪"における "スポーク" の形に配列するこ とができ、この場合には大きな輪形電解質源井戸 5 6 ′ は "車輪" の軸にある中心の電解質だまり 井戸5 8 ′ に接続されている。

 解質および電気泳動特性を有する試料は電解質源 井戸56内に置かれている。微小チャネルまたは 深溝54を介して、電解質および試料を電解質だ まり井戸の方へ移動させるため、電解質源電極お よび電解質だまり電極(図示されていない。)を 介して、電解質源井戸と電解質だまり井戸との間 に電界を印加する。電気泳動特性を有する試料の 成分が異なると電荷および移動度が異なるため. 掛小チャネル54を介して電解質だまり井戸58 の方へ試料成分が移動する期間には、それらの成 分は分離している。かくして、各チャネルでほん のわずかの量の電解質および試料が処理できるよ うに、微小チャネル54は極めて小さい断面積を 有しているとはいえ、大きさを最ることができる 程度の電気泳動性試料を処理するために、微小チ + ネルの断面積の小さなことが障害とはならない ように、微小チャネルの流出物は電解質だまり井 戸58へと浸入していく。

第3図(B)は本発明を説明するための、微小電気泳動デバイスの頂面図であり、微小チャネル

る。微小チャネル、電解質源井戸、および電解質 だまり井戸のかかる構成、ならびにその他の構成 は、すべて本発明の範囲に含まれるものである。

第3図(c)は本発明を説明するための、微小電気 泳動デバイスの頂面図であり、蛇管状パターンに 配置された微小チャネルのさらに他のレイアウト を示すものである。かかるレイアウトにより、他 の可能な形式のものよりもさらに小さな面積上に、 さらに長い電気泳動チャネルを実現できる。第3 図(c)に示すものとは別の巻き形パターン、あるい は曲がりくねった形のパターンも使用することも できるが、これらも本発明の範囲に含まれるもの である。

電気泳動法において、望ましくない帯域の広がりはジュール熱、渦泳動、および単純な分子拡散によって引き起こされることは公知である。かくして、緩衝媒体を介して電流が通過すると緩衝媒体が加熱され、これを分裂させるような対流が生ずる。毛細管、特に小口径の管を使用すると帯域の広がりが減少することも公知である。毛細管直

径を減ずると、表面の体積に対する比が大きのなり、熱消費効率が向上する。さらに、毛質の電気を減ずると、緩衝媒体、すなわち電解の電気を減ずなし、電解質派と電解質だまりといる。これは、電解質の基板内により、消費できるのに対しては、できるのに有利である。

上に議論したように、各数小チャネルの長手方向に沿って一つ以上の電極を造ることができることによって、数小チャネルの各部分に沿った電界を自由、かつ、正確に制御することができる。かかる能力を利用すれば、帯域を広げる作用をする分裂過程の生じないような技術を応用することができる。

第4図(A)~(D)は本発明を説明するため の電気泳動電解質の側面図であり、電圧をチャネ ルに印加する際におけるイオンの応答を示すもの

第4図(B)を参照して、電解質源井戸および電解質だまり井戸は零電位に保持され、一方で小さな正の電圧が電極60に印加されている。これによって、陰イオンが電解質源井戸からドリフトし、電極60の近傍で微小チャネル54の当該部分のイオン濃度が増加する。

これに示すようにはなられて、電解質だはなられて、電解質だはなられて、 では、ないではないでは、 のでは、 ので である。第3図を参照すると、"出発ゲート"電極60は第2図に示すような基板の一部分として、あるいは第1図におけるような被覆板の内面上に造られている。第3図(A)を参照して本発明の特徴が説明されているが、第4図(A)~(D)は微小電気泳動デバイスへの応用について記載したものであり、これらの技術は通常の大きさの従来形式の電気泳動デバイスに適用可能である。かかる応用も、すべて本発明の範囲に含まれるものである。

出発ゲート60は同一電解質源井戸の近傍に置かれて造られた金属の薄いトレースであり、チャネルを検切ってチャネルに垂直なものであるので、イオンの流れの方向に垂直なものである。

第4図(A)を参照すると、電解質源井戸、電解質だまり井戸、ならびに出発ゲートは、すべて最初に同一の相対電位に保持されている。この電位は、便宜的に接地電位、すなわち0ポルトであるとする。電解質および電気泳動性を有する試料は、電解質源井戸56内にデポジットされている。

ットが有効にピンチオフする。電気泳動過程が開始する前の長い期間に、出発ゲートはその近傍の イオンをフォーカスするので、希釈試料を濃厚に するためにも出発ゲートが使用できる。

上述したように、従来技術による電気泳動法における共通した問題は帯域の広がり、すなわちことは料の広がり、でいるののあるのでは単純な分子拡散である。第3図(C)を参照したように、第4図(D)を参照したように、第4図(D)を参照したように、第4図(D)を参照したように、第4図(D)を参照したとののののである。第4図(C)を参加を表がまる。第4図の近路である。第5をは、またののではより、からるに、できる。できる。

第5 図は、微小チャネルの長さ全体にわたって拡 散を減ずるためのものであり、かつ、パケットに おけるイオンあるいは分子を連続的にフォーカス するのに供せられる多重電極アレイを備えた微小 電気泳動デバイスの頂面図である。第6図(A), 第6図(B)は本発明における、この模様を詳細 に説明するものである。

第6図(A)は微小電気泳動デバイスの部分断 面、および部分系統を示す図である。電解質源か ら電解質だまり (図示していない。) へのイオン, あるいは分子の望ましい通過方向は、電極の下流 の位置、あるいは上流の位置を定義するものであ る。かくして、 e 2 は e 1 の下流にあるものであ り、 e 6 は e 8 の上流にあるものである。第 6 図 (A) に示すように、延長形電極100は電極が それぞれ3つずつのグループに分けられていて. 微小チャネルとは横方向にアレイ状に配置されて いる。電極に印加された電圧は、第6図(B)に 示されている。第6図(A), 第6図(B) に示 すように、クロック1は電極e1, e4, e7. e 1 0 を制御し、クロック 2 は電極 e 2, e 5. e 8 を制御し、クロック 3 は電極 e 3 、 e 6 、 e 9 を制御する。時刻tぃにおいて、クロック1はーV の電圧を印加するものである。電解質源井戸内お

よび微小チャネル内で, 電極 e 1, e 4, e 7, elOが近傍電極より低電圧に保たれているので、 クロック1での-Vの電圧によって電極 e 1, e 4. e 7. e 1 0 の近傍に正イオン、あるいは正に帯 電された分子が引きつけられる。続く時刻tzに おいて、電極 e 1 , e 4 , e 7 , e 1 0 はーVに 保たれている一方で、クロック2もーVの電圧を 電極 e 2 , e 5 , e 8 に印加されている。これに よって、第6図(B)にグラフ的に示すように、 最初に電極 e 2, e 5, e 8 の近傍では微小チャ ネルの当該部分の方向に, 電極 e l, e 4, e 7 の近傍の正のイオンが下流に移動する。続く時刻 t , において、電極 e 2 , e 5 , e 8 の電位は -Vに保たれているが、電極 e 1, e 4, e 7, e 10の電位は-V/2に変化する。さらに、これ によって電極 e 2, e 5, e 8 の近傍ではチャネ ルの当該部分の方向へ、時刻tlにおいて最初に、 これらの電極の近傍に引きつけられたイオン、お よび分子を動かすため、これらのイオンおよび分 子の動きが加速される。続く時刻t4において、

電極 e 2 , e 5 , e 8 の電位は変化しないが、電極 e 1 , e 4 , e 7 , e 1 0 は接地される。これによって、最近に電極 e 1 , e 4 , e 7 の近傍にあったイオン、あるいは分子は、全て電極 e 2 , e 5 , e 8 の方に移動する。

時刻 t 1~ t 4 のそれぞれにおいて、電極を介して荷電イオンあるいは荷電分子に加えられた電界は、分子拡散力に対抗する力を加え、上に図で説明したように希望する電極の近傍のイオン、あるいは分子を有効にフォーカスする。かくして、時刻 t 1において最初に電極 e 1、 e 4、 e 7の下に集められたイオンあるいは分子は、パケットを形成するようにフォーカスされたまま、時刻 t 4において電極 e 2、 e 5、 e 8 の下の微小チャネルの当該部分に移動する。

それゆえ、拡散によって生じた帯域の広がり、す なわち、にじみの効果は減ぜられた。

上記サイクルにおいて、クロック3によって制御された電極 e 3 , e 6 , e 9 は、下流方向へ他の電極の下からイオンが拡散してゆくのを防ぐた

め、零ポルトに固定されていた。時刻 t 5 においては、t 2 の電圧パターンを繰り返すが、空間的に1 電極分だけ下流に移動するように、クロック2 3 はーVに保持され、電極 e 1、e 4 に印加されたクロック1 は 0 に保持されている。時刻 t 6 においては、t 3 の電圧パターンを繰り返すが、空間的に1 電極分だけ再び移動する。第6 図 ( クルごとに電圧パターンが繰り返されるが、空間的には1 電極分だけ移動することがわかる。時刻 t 7 (図示していない。)に保持され、ウロック1、2、3 はそれぞれ 0、0、一Vに保持され、時刻 t 1 (図示していない。)に保持され、時刻 t 1 における状態と同様である。

第6図(A),第6図(B)は"3相"方式を 図で説明したものであるが、これは多くの可能な 構成の一つにすぎない。同様な構成は電荷結合素 子において、荷電キャリアが基板内の一点から他 の点へと移動する模様を示すのに記載してある。

第7図は、連続した時刻 t 1 ′~ t 8 ′において、多重電極アレイを採用した微小電気泳動デバイス内の電極 e 1 ~ e 1 3 に印加される電圧を示す図である。かくして、時刻 t 1 ′において電圧 – V が電極 e 1 に印加され、これによって正に帯電されたイオン、あるいは分子が電極 e 1 の下の

電されたイオン、あるいは分子が電極 e 1 の下の いは分子は電極 e l の下の位置から電極 e 2 の下 の位置、さらに電極 e 3 の下の位置へと移動する 電圧に従って移動することができる。小さい移動 度のイオンあるいは分子は、時刻 t 2 '、 t 3 ' において、電解質源井戸、あるいは電極elの近 傍に留まっている傾向にある。かくして、 電圧波 形先端のスイープ周波数を制御することにより. 種々の移動度を有する荷電イオンあるいは荷電分 子をフィルタして除去することは可能である。 もちろん、移動する電圧波形先端は多重電極のア レイの他の部分で繰り返すことができる。かくし て、第6図(A)、第6図(B)において、パタ - ンは3つの電極ごとに繰り返される。かかる場 合には、異なった移動度を有する分子。あるいは イオンをフィルタして除去することは、パターン を繰り返す電極間の距離にも依存する。第6図 ′

(A), 第6図(B) におけるように密にパター

ンが繰り返されるところでは、小さな移動度を有

する分子、あるいはイオンを電解質だまりの方へ

移動させることが可能である。スイープレート、

微小チャネルの当該部分の方向に引きつけられている。 残りの電極 e 2 ~ e 1 3 は接地されている。 競りの電極 e 2 ~ e 1 3 は接地されている。 競く時刻 t 2 において、負の電圧 ー V が電極が接地されて、電極 e 2 の下の数小チャネルの当該部分の方にみから、第7 図に示すように、続く時刻 t 3 ~ t 8 ′の期間には、任意時刻において負電圧ー V が 1 電極分だけ移動し、これによって正イオン あるいは正分子のパケットが一つの電極の下へと、チャネルの当該部分の方向に移動する。

上に記述したイオンあるいは分子の運動は、電圧移動の周波数に耐えるに十分な高い移動度を有する成分のみに適用される。電圧移動の間の時間間隔に依存して、全てのイオンあるいは分子が当該時間間隔内に隣接電極へ移動するのに十分な移動度をもっているわけではない。かくして、時刻t1'、t2'、t3'間の時間間隔が相対的に短いと仮定すると、高移動度を有するイオンある

すなわち電圧パターンを繰り返す電極間の空間を 増加させることにより、低速のイオンあるいは粒 子を識別することができる。

簡易に、電圧 - Vが印加された電極は第7図における太線の塗りつぶした四角形として示してあり、 一方、接地してある電極は中空の白い四角形として示してある。

同様な規定は第8図に適用される。

第8図(A)に示すように、電圧-Vの印加される隣接電極の数は、第8図に示すように、時刻t 1 から時刻t 8 への時間内に減少する。これによって、最初に幾つかの電極の下の微小チャネルの下の微小チャネルの下の微小チャネルので電子がつている荷電イオン、あるいは荷電分子がつまったない。 第8図は、電極数が6から5、5から4、4から3へと減少し、時刻t 5 において2になり、t 8 では変化しないことを示しているが、他の一様に減少する関数関係も使用でき、これも本発明の範囲に含まれるものと理解されよう。再び、上記

技術は通常の大きさの、従来技術による電気泳動 デバイスに対して適用可能である。第6図(A)、 第6図(B)、第7図、および第8図に示すよう に、複数の電極に対して異なったシーケンスの電 圧を印加する方式は、単純に従来技術を採用して 実現する事ができる。

第6図(A)、第6図(B)、第7図、第8図
(A)における系統の代表的実施例は、N個の出力状態を有し、それぞれの出力状態が各電極電圧パターンに対応させるように構成したパイナリカウンタを使用するものである。第8図(B)、第7図、おはの第8図(A)において多重電極を駆動するのである。第8図(A)において多重電極を駆動するのである。第8図(B)に示すように、カウンタの出力にある。第8図(B)に示すように、カウンタの出力に表したが変に、カウンタの出力に表現に対応によりに対応によりに対応によりに対応によりに対応を表現した。メモリのとは表現によりに表現して、大きには、表現である。

きる。第6図(A)、第6図(B)、第7図、および第8図の関係で、上述の連続したフォーカス技術およびフィルタ技術は、従来技術によって造られた電気泳動性ゲルの最上部上に、多重電極アレイを有する第10図の電気泳動デバイスとして適用することができる。管状媒体のような他の電気泳動性を有する媒体に対して上記と同一の特徴をかかる目的に応用すること、ならびにその他の目的に応用することも、本発明の範囲に含まれるものである。

チャネル壁面の化学的機能化は、従来技術による管状媒体での電気泳動において使用されるものと同様な方法で行われる。言い換えれば、分析されているイオン、あるいは分離されているイオンは自互作用を得るためには立って、電気泳動特性を有する管に従来技術であるので、電気泳動特性を有する管に従来技術

伴って、メモリデバイス内部に格納された電極活性化パターンは複数の電極(ゲル上に置く場合にはガラス上の電極)に印加される。基板がシリコンであるならば、かかる回路は上述したように、チャネルとともに集積化される。

によって適用された技術を適用できる。 チャネル壁面に対する他の適切な被覆物には,窒

化シリコンおよび有機重合体が含まれる。

半導体基板が微小チャネルを造るのに使用され るならば、放射性粒子が入射したときに電子/正 孔対が生成される形式のPINダイオードのアレ イのような放射線検出回路を直接、同一基板上に 造ることが可能である。かかる検出器は、粒子の 研究に使用されている。かかる検出器によれば、 益小チャネル内の試料からの放射性符号の付けら れた分子を検出することができる。第11図は、 本発明を説明するための、検出器を備えた数小電 気泳動デバイスの頂面図である。第11図に示す ように、延長構造のPINダイオード122は敬 小チャネル54に対して横方向になるように配列 されている。微小チャネル54は実質的に相互に 平行し、ダイオード122は実質的にチャネルに 対して垂直である。これによって、平行して流れ ているグループを検出することができる。

第12図は、多重化されたPINダイオード1

0 4 の採用を示す図である。ダイオードアレイ1 0 4 により、微小チャネルアレイの全長にわたる "画像"の検出が可能であり、予め与えられた時間での表示が可能である。時間全体にわたる和によれば、異なったグループの分子の相対輸送速度の分析が可能である。従来のパターン認識技術を利用し、この情報を直接、電子計算機に入力すると、帯のパターンあるいはあるパターンの欠けを自動的に識別することができる。

PINダイオード、ホトトランジスタ、あるいは電荷結合形扱像素子 (シンチレーション材料を同時にデポジットしたもの、あるいは上記デポジットをしないもの。) のような光検出器を基板へ集積化することも可能である。

検出回路の他にかかるデバイスの集積化は、金属電極、トランジスタ、および他の回路をデポジットするため、第2図を参照して上に記述したのと同様な方法で行われる。適当な波長の外部流入光が入射したか、あるいはレーザ光源で励起されたとき、符号付けされた蛍光体を検出するのにか

る電解質および試料の当該部分を介して流れる電流の測度である。かかるインピーダンスは、電極152、154を通過しているイオンあるいは分子の形式を指示したものである。 濃度および成分の変化によってもたらされた局部インピーダンスの変化は、かなりの大きさであるので、検出された信号をノイズと区別することは現実的である。 小信号正弦波解析(直接のインピーダンス測定) あるいはフーリエ信号解析の技術は、電極152、154を通過する特定成分の存在を決定するために使用できる。直接のインピーダンス測定技術は、次の文献に記載されている。

(1)エル・ハウスら、 "バクテリア成長の検出における電極および電解質のインピーダンス、" 米国電気電子学会、生医工学論文誌、BME-28巻、第5号、(1981年5月)。

(2)ジェー・アール・マクドナルド(編), "インピーダンス分光学," ジョーン ウイリー・アンド・サン社, ニューヨーク (1987)。

上記のように基板内へ検出器を造る代わりに、

かる光検出器が使用される。

集積化された輻射検出器は、微小チャネルと一直 線上に並べることができる。

問題になっているイオンが検出器を通り抜ける に伴って、局部インピーダンス変化を検出するた めにも電気化学検出器を使用することができる。 第13図は、本発明を説明するための、微小電気 泳動デバイスの一部分の部分的系統, ならびに部 分的断面を示す図である。かくして、電流は電解 貫源150から、微小チャネル54内の電解質お よび試料に接触した電極152(代表的にはプラ ·チナ、あるいはイリジウムのような貴金属)へと 流れる。電流は、電極152、154の近傍の電 解質ならびに試料の一部分を通り、電極154の 方へ流れ、さらに抵抗器156を介して接地へ流 れる。節点158における電圧は増幅器160。 および他の回路により検出される。(第13図に は、この模様は図示されていない。) かくして、 抵抗器156が固定抵抗器であれば、節点158 における電圧は電極152.154の近傍におけ

第14図に示すように、検出器のアレイを数小チャネル上に機械的に置くことができる。第14図に示すように、検出器のアレイ200は電気泳動デバイス250の数小チャネル254の上部、あるいはその頂部上の機械的手段により精密に一直線に配列されている。

これにより、電気泳動過程が完了するとアレイ 2 0 0 を除去できる。かくして、デバイス 2 5 0 のみが上記完了とともに処分され、検出器アレイ 2 0 0 は将来の過程で再使用される。上に記述し、第 9 図および第 1 0 図に示したような、将来技術による電気泳動ゲルの頂部上に使用されるべき多重電極アレイについて、前記検出器はアレイと同一の基板上に造られる。

かくして、上記本発明によれば、研究および単独の開業医の診療所においてさえも使用できる能力を有する、低靡で臨床応用が可能な DNAシーケンサ、および他の顔定機器を提供することができる。 装置および方法の種々の詳細は、単に本発明を図示するものである。 かかる詳細を種々に変

形したものは、特許請求の範囲によってのみ限定されるべき本発明の範囲に含まれるものであると 理解されよう。

#### 4.図面の簡単な説明.

第1図は、本発明の一実施例を説明するための. 微小電気泳動アレイの一部分の断面図である。 第2図は、本発明の第2の実施例を説明するため の, 微小電気泳動アレイの一部分の断面図である。 第3図(A)は、本発明を説明するための、微小 チャネルおよび出発電極のレイアウトを示すもの で、微小電気泳動デバイスの頂面図である。 第3図(B)、(C)は、本発明を説明するため の、数小チャネルの代替品のレイアウトを示すも ので、微小電気泳動デバイスの頂面図である。 第4図(A)~(D)は、本発明を説明するため の, 電気泳動デバイスの側面図である。 第5図は、本発明を説明するための、多重電極を 有する電気泳動デバイスの頂面図である。 第6図(A)は、本発明を説明するための、電気 泳動デバイスの部分的断面および部分的系統を示

す図である。

第 6 図 (B) は、本発明を説明するための、第 6 図 (A) の電極に印加される電圧波形を示したも のである。

第7図は、本発明を説明するための、デバイス内の電気泳動性を有する試料上で、電気泳動デバイス内の一対の電極に印加された一対の電圧の効果を図示して説明したものである。

第8図(A)は、本発明を説明するための、デバイス内の試料上で、電気泳動デバイス内の一対の電極に印加された他の一対の電圧の効果を図示して説明したものである。

第8図(B)は、第6図(A),第6図(B), 第7図、および第8図(A)において多重電極を 駆動するのに適した2進カウンタ形回路のブロッ ク図である。

第9図は、本発明を説明するための、分離用媒体 としての従来技術による電気泳動性ゲルを採用し た電気泳動デバイスの頂面図である。

第10図は、本発明を説明するための、多重電極

を有し、かつ、従来技術による電気泳動性ゲルを 採用した電気泳動デバイスの頂面図である。

第11図は、本発明を説明するための、検出器を 備えた電気泳動デバイスの頂面図である。

第12図は、本発明を説明するための、複数の検 出器を備えた電気泳動デバイスの頂面図である。 第13図は、本発明を説明するための電気泳動デ バイスの部分的系統および部分的断面を示す図で ある。

第14図は、本発明を説明するための、いかにして外部検出器を微小電気泳動デバイスに対して結合することができるかを図示するための微小電気 泳動デバイスの斜視図である。

- 1, 2, 3, 23 ... / ロック
- 20, 250 … デバイス
- 2 2 …基板
- 2 4. 4 4 … 深溝
- 5 4, 5 4 ′…深溝 (微小チャネル)
- 26,46…被覆板
- 2 6 a ··· 内侧表面

- 28…金属トレース
- 40…微小電気泳動デバイス
- 42…半導体基板
- 4 8 … 金属電極
- 50 ... MOSFET
- 52…二酸化シリコン
- 5 6 , 5 6 ′ … 電界質源井戸
- 5 8 , 5 8 ′ …電界質だまり井戸
- 60…電極
- 6 2 … 矢印
- 100…延長形電極
- 104, 122 ··· PINダイオード
- 150…電界質額
- 152.154…電極
- 156…抵抗器
- 158…節点
- 1 6 0 … 増幅器
- 200…検出器のアレイ
- 254…微小チャネル

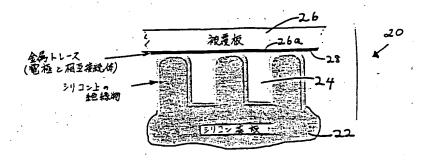
#### 特許出願人

ザ、ポード、オブ、トラスティーズ、オブ、 ザ、リーランド、スタンフォード、ジュニア、 ユニバーシティ

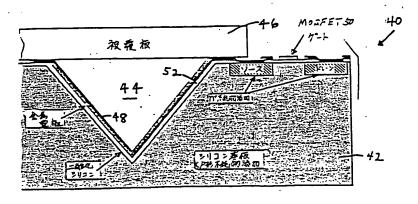
代理人 弁理士 井ノ口 春

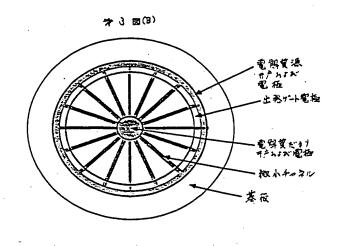
1942の ではられた54 放入するネル

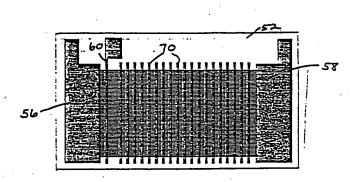
ツ1 図



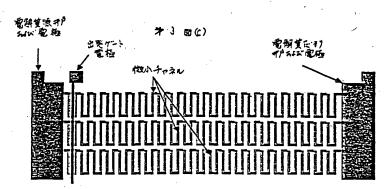
タ2 図

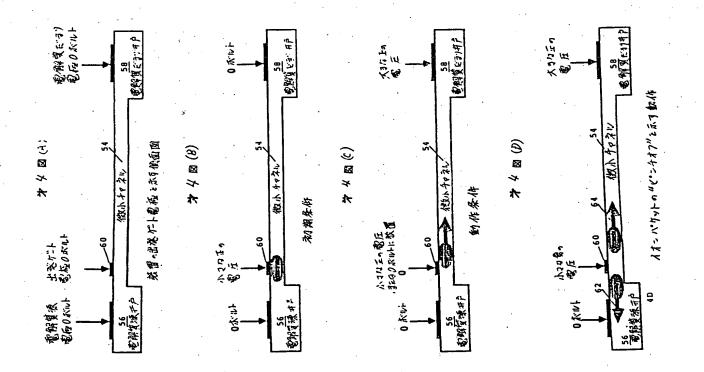


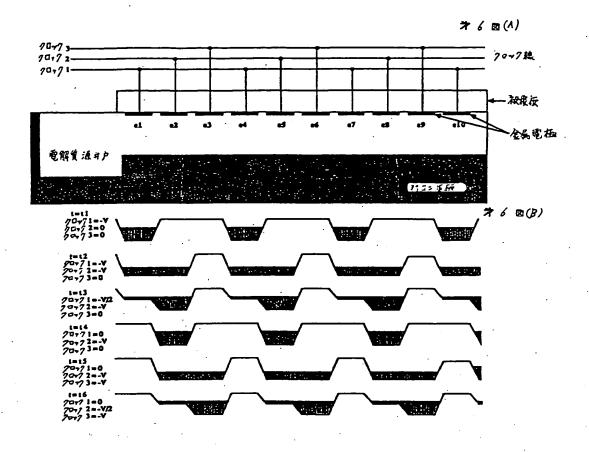




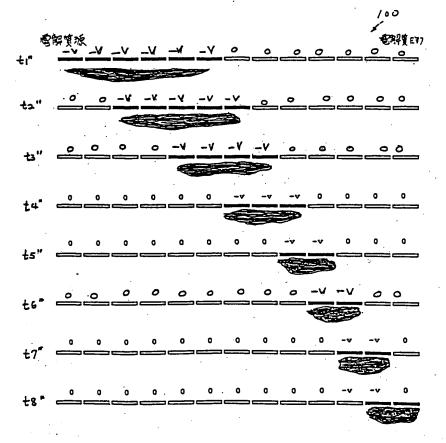
**≯** 5 ⊠

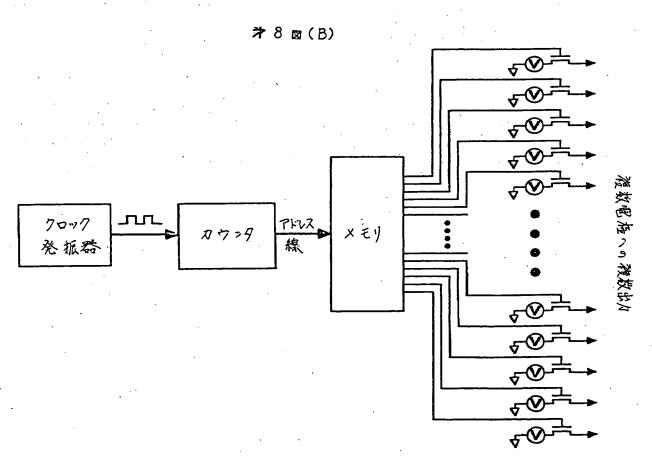




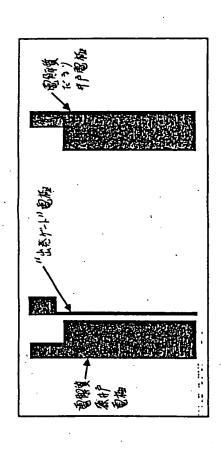


Æ					4										•
- E	3	0	e13	O	e13	٥	e13	٥	ė13	٥	£.	0	3	ام	] []
100 600	ទ	٥	e12	0	e12. e13	0	•12	٥	912	0	ੂ <b>ਫ</b>	٥	e12	0	412
7 0	์ฮิ	٥	•11	0	118	0	11.0	٥	110	٥	วิ	٥	e11	0	e11
. 0	<u>8</u>	[0	910	٥	• 10 • 10	٥	•10	٥	e 10	٥	9	۰	e 10	١٥	e10
0	5	٥	6	٥	6	٥	6	٥	•	٥	5	٥	69	٥	69
0	<b>3</b>		. 80	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	88	٥	of os e6 o7 o8 e9 e10 e11 e12 e13	٥	ol e2 e3 e4 (22) e6 e7 e8 e9 e10 e11 e12 e13	٥	8	٥	89	۲ آ	8
0	[5	٥	6	٥		٥	67	۰		٥	ร	آ ڄ	5	اًه	9 (0
0	ತ		9	0	9	٥	9	٥	9	7	30	٥	96	آه	90
•	រ		8	0	es S	٥	28	>	S S	٥	ង	٥		آه	Ş
0	์เรี	0		٥	7	7	9:	٥	7	٥	र्व	٥	7	اً ٥	7
0	ខ	0	•	٦	A:	0	3		3	٥	e3	٥	3	٥	G
0	ដ	۱۲	<b>3</b> .		<b>7</b> .	0	65	0	7	٥	ಭ	٥	2	١٥	7
· 221.1 2014.>	9	٥	7		01 02	0 0 0	10	0	7	0	el ez e3 e4 e5 e5 e9 e9 e10 c11 ez e13		al e2 al e4 e5 a6 (NIP) e8 a9 a10 a11 e12 a13	] ه	el e2 el e4 e5 e6 e7 (550 e9 e10 ell e12 ell
多的变形。 1000000000000000000000000000000000000	อ ว	ţ.		ţ;	}	ţ,		- A		- 4	3	17,		187	





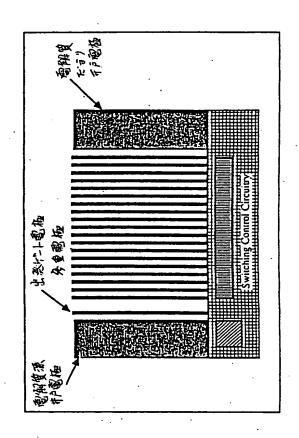
⊠ //\* rd 14% MId



6

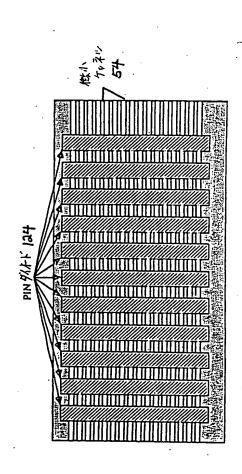
4

図 0/ 木

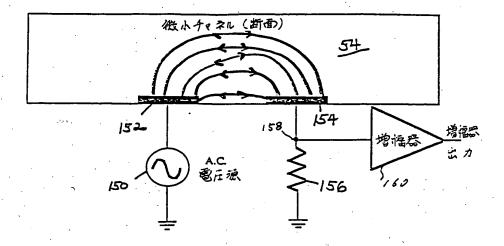


學-PIN974年片式及的(党先)為.検出器

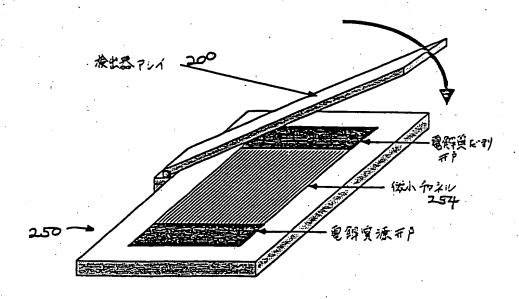
.



\* /3 ⊠



**≫**/4 ₽



#### 手統補正書學

平成 2年 3月27日

一种乔宁县官员

1. 事件の表示

平成1年 特 許 頭 第338028号

2.克明の名称

#### 不但太汉团

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

住 所

デ、ポード、オブ、トラスティ*ーズ*、オブ、ザ、リーランド、 スタンフォード、ジュニア、ユニバーシティ

(V

名程

4.代 選 人

住 所 ●160 東京都新宿区歌舞伎町2丁目45番7号 大喜ビル4P 電話 (03) 209-1094

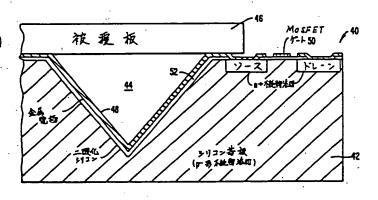
氏名 (7514) 弁理士 井ノロ 専門子

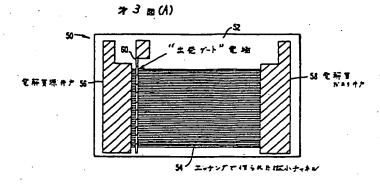
5. 補正命令の日付 自 発

6. 補正の対象 図 面

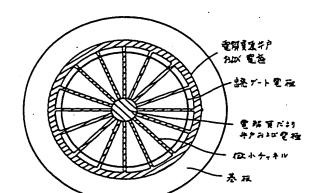
7. 描正の内容

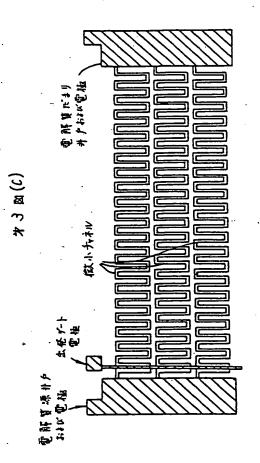
才 2 因

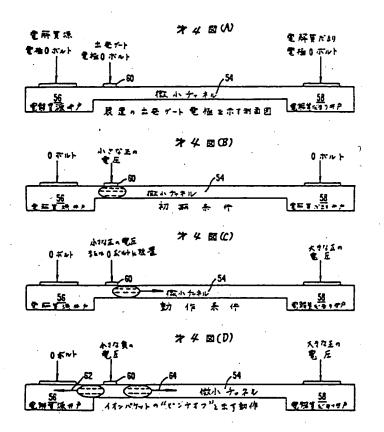




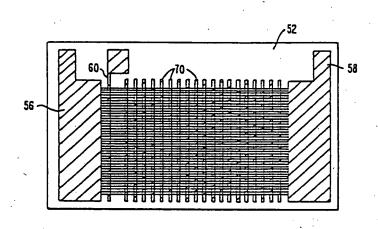
≯3 ⊠(B)

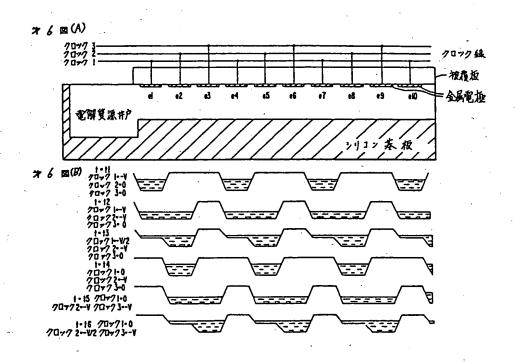






**≯** 5 🛭





\* 7 m

## 2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 e10 e11 e12 e13

15 d e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 e10 e11 e12 e13

16 d e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 e10 e11 e12 e13

17 d e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 e10 e11 e12 e13

18 d e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 e10 e11 e12 e13

19 d e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 e10 e11 e12 e13

10 d e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 e10 e11 e12 e13

10 d e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 e10 e11 e12 e13

10 d e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 e10 e11 e12 e13

11 d e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 e10 e11 e12 e13

12 d e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 e10 e11 e12 e13

13 d e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 e10 e11 e12 e13

14 e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 e10 e11 e12 e13

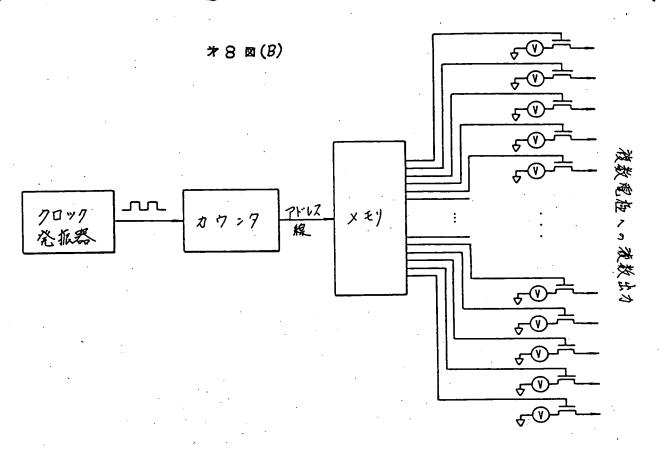
15 d e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 e10 e11 e12 e13

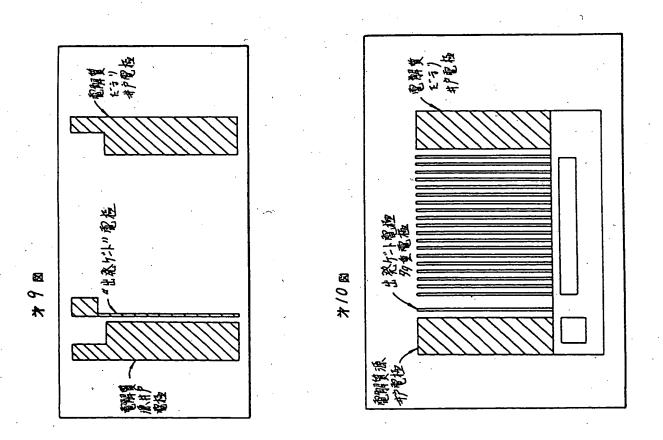
16 d e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 e10 e11 e12 e13

17 d e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 e10 e11 e12 e13

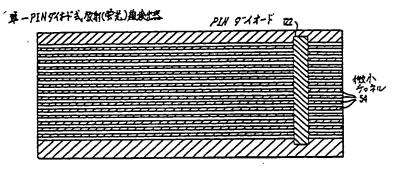
18 d e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 e10 e11 e12 e13

才 A 图(A)

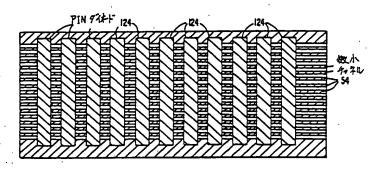


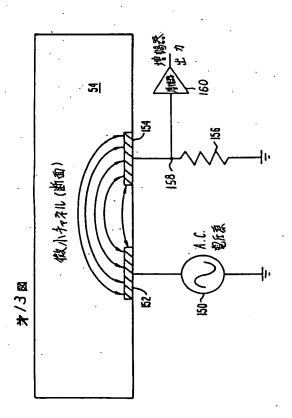


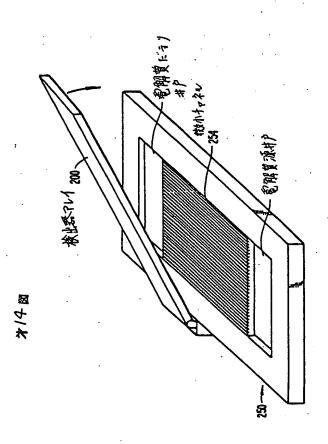
**≯**// ⊠



**沖/2**國 .







#### 手統 補正 善成

平成 2年 4月24日

特許庁長官股

1. 事件の表示

圃

平成1年 特 許 闡 第338028号

2. 発 明 の 名 称

能気冰動系

3. 猫 正 を す る 者

事件との関係 特許出願人

住 所 ザ、ボード、オブ、トラスティーズ、オブ、ザ、リーランド、スタンフォード、ジュニア、ユニバーシティ

名 称

4. 代 理 人

住 所 ●160 東京都新宿区歌舞伎町 2 丁目 4 5 番 7 号 大喜ビル 4 F 電話 (03) 209-1094

氏名(7514)#理士 井 ノ 口 東门野翔

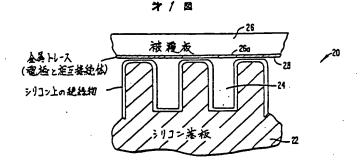
5. 補正命令の日付

平成 2年 3月27日

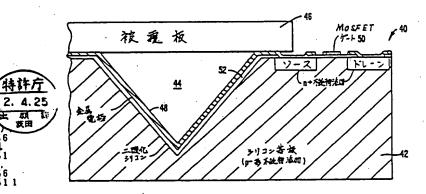
6. 補正の対象 委任状 および 図 面

7. 補正の内容

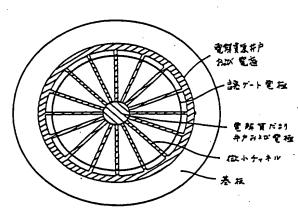
(1)委任状を補正する。
(2)添付図面の第1図 第2図 第3図 (A) , 第3図 (B) , 第3図 (C) 第4図 (A) , 第4図 (B) , 第4図 (C) , 第4図 (D) , 第5図 第6図 (A) , 第6図 (B) , 第7図 第8図 (A) , 第8図 (B) , 第9図 第10図 第11図 第12図 第13図 および第14図を、別添の第1図 第2図 第3図 (A) , 第3図 (B) , 第3図 (C) , 第4図 (A) , 第4図 (B) , 第4図 (C) , 第4図 (A) , 第6 (B) , 第7図 第8図 (A) , 第8図 (B) , 第9図 第10図 第11 (B) , 第12回 第13回 および第14図に補正する。

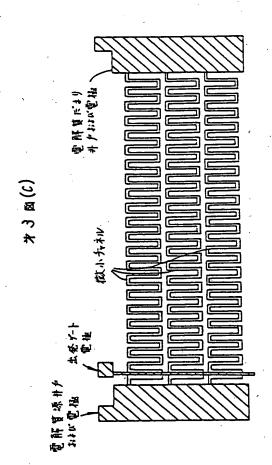


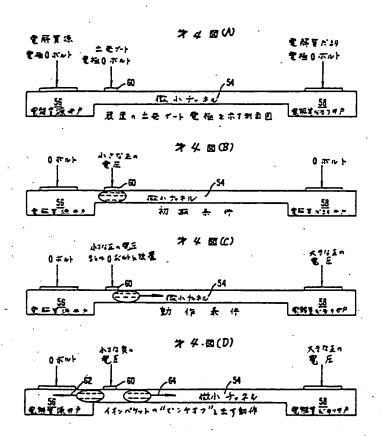
72 0



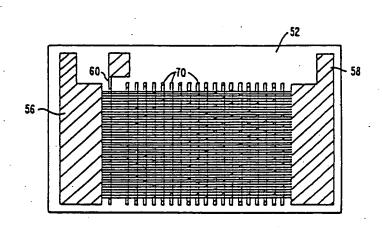
≯ 3 ⊠(B)

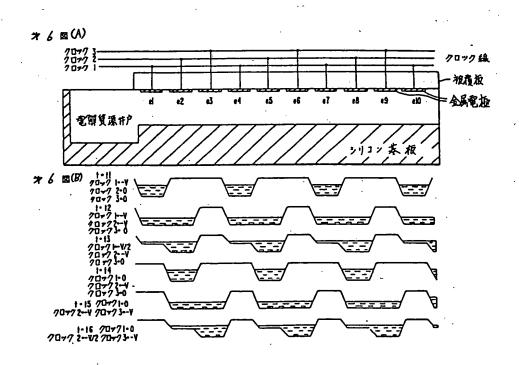






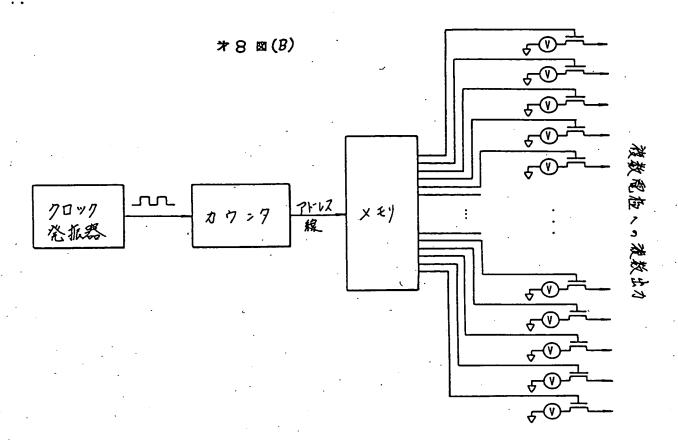


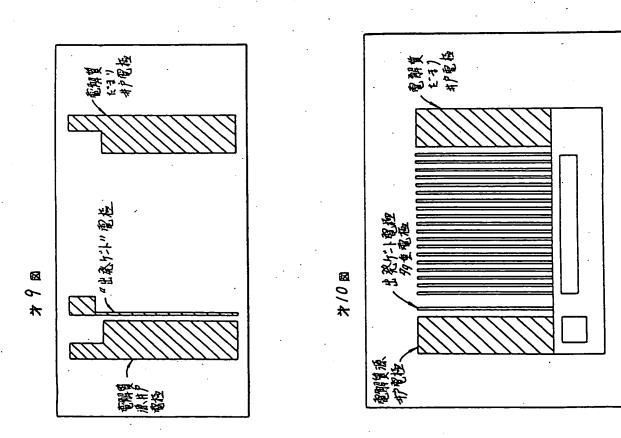




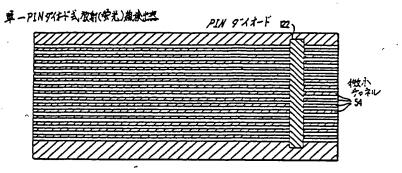
#### \* 7 m

#### **≯8 図(A)**





**≯// ⊠** 



**オ/Z**図

